

**Техническая спецификация на проведение совместных научных исследований по
нанесению покрытий в вакууме
(Лот 4)
Общие требования**

Основные технологические этапы осаждения покрытий в вакууме и его техническая характеристика приведена ниже:

Назначение: Нанесение покрытий с алюминиевым, танталовым, титановым, цинковым, и нитридным покрытием, напыленных из паровой фазы в вакууме.

Тип: движение полосы через шлюзы на входе и на выходе из камер.

Ширина полосы: 340—420 мм.

Толщина полосы: 0,2—0,6 мм.

Скорость полосы: 0,2—3,0 (5,0) м/с.

Мощность для предварительного подогрева полосы: электронный луч Р 2 X 250 кВт.

Мощность для испарения: электронный луч Р 2X250 кВт.

Нанесение покрытия с обеих сторон.

Материал покрытия: алюминий, цинк, нитрид титана.

Форма подаваемого материала покрытия: проволока, плоские образцы 10x10 мм.

Основные технические характеристики:

Рабочая камера: не менее 200x160x140, мм

Шлюз (2 шт) -160x40x40, мм

Давление в камере: не менее 1×10^{-3} Па

Мощность магнетронного источника: 25 кВт

Параметры ионного источника:

Ускоряющее напряжение до 2000 В

Рабочий ток до 2 А

Производительность-10-30 мм/с

Размер ионного пучка на срезе анода: Не мене 140x10 мм

Размер рабочей зоны по нормали к подложке: 0-40 мм

Наличие модуля предварительной подготовки ионного источника.

Возможность контроля толщины покрытий в режиме осаждения, с выводом спектральной характеристики на компьютер.

И.о ректора



Рахметуллина С.Ж.

Руководитель программы

Плотников С.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Перед приобретением согласовать с заказчиком.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.